

研究評価委員会
「省エネエレクトロニクスの製造基盤強化に向けた技術開発事業」(中間評価)
分科会

日時：2023年6月20日(火) 10:00～16:50

場所：NEDO 川崎 2301/2302/2303 会議室 (オンラインあり)

議事次第

(公開セッション)

1. 開会、資料の確認	10:00～10:05	(5分)
2. 分科会の設置について	10:05～10:20	(15分)
3. 分科会の公開について	—	
4. 評価の実施方法について	—	
5. プロジェクトの概要説明	10:20～11:20	(60分)
5.1 意義・社会実装までの道筋		
5.2 目標及び達成度		
5.3 マネジメント		
5.4 質疑応答		

[説明 40分、質疑応答 20分]

(非公開セッション)

6. プロジェクトの詳細説明		
6.1 研究開発項目①「新世代パワー半導体の開発」		
・①-1「酸化ガリウムパワー半導体の開発」		
	[説明 20分、質疑応答 20分]	11:25～12:05 (40分)
	休憩(昼食)	12:05～13:05 (60分)
・①-2「大口径インテリジェント・シリコンパワー半導体の開発」		
	[説明 20分、質疑応答 20分、入替 5分]	13:05～13:50 (45分)
6.2 研究開発項目②「半導体製造装置の高度化に向けた技術開発」		
・②-1「次世代不揮発性メモリ向け成膜装置の開発」		
	[説明 20分、質疑応答 20分]	13:50～14:30 (40分)
	休憩	14:30～14:40 (10分)
・②-2「3Dインテグレーション研究開発」		
	[説明 20分、質疑応答 20分、入替 5分]	14:40～15:25 (45分)
・②-3「直描露光機に関する高解像度化開発」		
	[説明 20分、質疑応答 20分]	15:25～16:05 (40分)

7. 全体を通しての質疑	16:05～16:20 (15分)
休憩	16:20～16:30 (10分)
(公開セッション)	
8. まとめ・講評	16:30～16:45 (15分)
9. 今後の予定	16:45～16:50 (5分)
10. 閉会	